

供媒體即時發佈

投資者關係：

Ed Lockwood

投資者關係資深總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係：

Meggan Powers

企業宣傳資深總監

(408) 875-8733

meggan.powers@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣佈推出新型 Teron™ SL650 光罩檢測系統

高產能和 193nm 技術有助於積體電路晶圓廠

經濟有效地監測 20nm 以下設計節點光罩

【加州 MILPITAS 2014 年 5 月 20 日訊】，[KLA-Tencor 公司](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）今天宣佈推出 Teron™ SL650，該產品是專為積體電路晶圓廠提供的一種新型光罩品質控管解決方案，支援 20nm 及更小設計節點。Teron SL650 採用 193nm 照明及多種 STARlight™ 光學技術，提供必要的靈敏度和靈活性，以評估新光罩的品質，監控光罩退化，並檢測影響良率的光罩缺陷，例如在有圖案區和無圖案區的霧狀增長或污染。此外，Teron SL650 擁有業界領先的產率，可支援更快的生產週期，以滿足檢驗更多數量的先進多重曝光成型光罩的需要。

KLA-Tencor 副總裁兼光罩產品事業部 (RAPID) 總經理熊亞霖博士稱：「對於積體電路製造商而言，瞭解光罩狀況是圖案成像製程控管的核心要素，因為光罩品質變化能對印出的每一片晶圓造成毀滅性影響。針對 Teron SL650，我們的團隊在適合積體電路晶圓廠的一個緊湊平台上採用了最先進的光罩檢測技術，生產出一款具有先進靈敏度、高產能和可擴展至未來節點能力的光罩品質控管系統。透過監測新光罩的關鍵缺陷，並在生產期間識別掩模圖案的累積缺陷和變化，我們的 Teron SL650 能夠協助晶片製造商保證裝置良率、性能和生產週期。」

Teron SL650 使用 STARlightSD™ 和 STARlightMD™ 在單晶片和多晶片光罩上創造出更勝一籌的缺陷擷取率和全面的檢測範圍，藉此支援晶圓廠內各種類型的光罩。晶片製造商還可以使用創新型 STARlightMaps™ 技術來追蹤光罩隨著時間的退化，並確定臨界尺寸 (CD)、薄膜厚度、抗反射層以及光罩上的其他變異——這些光罩品質變化會影響微影製程視窗或圖案印刷。此外，Teron SL650 與超紫外線 (EUV) 相容，能夠與積體電路製造商及早協作，滿足晶圓廠對 EUV 光罩的要求。

多台 Teron SL650 光罩檢測系統已在世界各地的代工廠、邏輯電路與記憶體生產廠安裝，用於新光罩的品質檢測，以及先進積體電路製造中所用光罩的重新檢驗。為了保持高性能和高產能，滿足最先進的生產需要，Teron SL650 系統由 [KLA-Tencor 的全球綜合服務網路](#) 提供支援。關於 Teron SL650 光罩檢測系統的更多資訊，請見 [RAPID 積體電路晶圓廠系列產品網頁](#)。

關於 KLA-Tencor：

KLA-Tencor 公司是製程控管與良率管理解決方案的領先提供商，它與全球客戶合作，開發先進的檢測與度量技術。這些技術為半導體、發光二極體 (LED) 及其他相關奈米電子產業提供服務。公司擁有廣泛的業界標準產品系列及世界一流的工程師與科學家團隊，超過三十五年一直為客戶努力打造優秀的解決方案。KLA-Tencor 的總部設在美國加利福尼亞州米爾皮塔斯 (Milpitas)，並在全球各地設有專屬的客戶營運與服務中心。如需更多資訊，請參觀網站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性聲明：

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 Teron SL650 光罩檢測系統的預期效能，Teron SL650 光罩檢測系統相對於未來技術節點的可擴展性，半導體產業的趨勢及其帶來的預期挑戰，KLA-Tencor 的客戶對 Teron SL650 光罩檢測系統的預期使用，以及 Teron SL650 光罩檢測系統使用者可以實現的預期成本、營運與其他受益等陳述，均為前瞻性聲明，並受到《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 規定的「安全港」(Safe Harbor) 條款的制約。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，且包含諸多風險與不確定性。由於各種因素，包括延遲採用新技術（無論是由於成本或效能問題抑或其他問題），其他公司推出競爭性產品，或影響 KLA-Tencor 產品的實現、效能或使用的意外技術挑戰或限制，因此實際結果可能與此類聲明中的預計結果實質不同。

###